

ML6277

1/4

**PCT REQUEST**

Paper Copy

<b>0</b>	<b>For receiving Office use only</b>	
0-1	International Application No.	
0-2	International Filing Date	
0-3	Name of receiving Office and "PCT International Application"	
<b>0-4</b>	<b>Form PCT/RO/101 PCT Request</b>	
0-4-1	Prepared Using	JPO-PAS 0321
<b>0-5</b>	<b>Petition</b>	
	The undersigned requests that the present international application be processed according to the Patent Cooperation Treaty	
<b>0-6</b>	<b>Receiving Office (specified by the applicant)</b>	
0-7	<b>Applicant's or agent's file reference</b>	
<b>I</b>	<b>Title of Invention</b>	
	PROCESSING METHOD OF SILICON WAFER	
<b>II</b>	<b>Applicant</b>	
II-1	This person is	
II-2	Applicant for	
II-4	Name	
II-5	Address	
II-6	State of nationality	
II-7	State of residence	
II-8	Telephone No.	
II-9	Facsimile No.	
II-11	Applicant's registration No. with the Office	

BEST AVAILABLE COPY

**PCT REQUEST**

Paper Copy

<b>III-1</b>	<b>Applicant and/or inventor</b>	
III-1-1	This person is	<b>applicant and inventor</b>
III-1-2	Applicant for	<b>US only</b>
III-1-4	Name (LAST, First)	<b>KOYATA, Sakae</b>
III-1-5	Address	<b>c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058634 Japan</b>
III-1-6	State of nationality	<b>JP</b>
III-1-7	State of residence	<b>JP</b>
<b>III-2</b>	<b>Applicant and/or inventor</b>	
III-2-1	This person is	<b>applicant and inventor</b>
III-2-2	Applicant for	<b>US only</b>
III-2-4	Name (LAST, First)	<b>TAKAISHI, Kazushige</b>
III-2-5	Address	<b>c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058634 Japan</b>
III-2-6	State of nationality	<b>JP</b>
III-2-7	State of residence	<b>JP</b>
<b>IV-1</b>	<b>Agent or common representative; or address for correspondence</b>	
The person identified below is hereby/ has been appointed to act on behalf of the applicant(s) before the competent International Authorities as:		
IV-1-1	Name (LAST, First)	<b>SUDA, Masayoshi</b>
IV-1-2	Address	<b>Nissei Higashi-Ikebukuro Bldg., 11-1, Higashi-Ikebukuro 1-chome, Toshima-ku, Tokyo 1700013 Japan</b>
IV-1-3	Telephone No.	<b>03-3988-4326</b>
IV-1-4	Facsimile No.	<b>03-3986-4443</b>
IV-1-5	e-mail	<b>suda@suda-pat.com</b>
IV-1-6	Agent's registration No.	<b>100085372</b>

BEST AVAILABLE COPY

**PCT REQUEST**

Paper Copy

V	DESIGNATIONS		
V-1	The filing of this request constitutes under Rule 4.9(a), the designation of all Contracting States bound by the PCT on the international filing date, for the grant of every kind of protection available and, where applicable, for the grant of both regional and national patents.		
VI-1	<b>Priority claim of earlier national application</b>		
VI-1-1	Filing date	10 December 2003 (10.12.2003)	
VI-1-2	Number	2003-411287	
VI-1-3	Country	JP	
VI-2	<b>Priority document request</b>  The receiving Office is requested to prepare and transmit to the International Bureau a certified copy of the earlier application(s) identified above as item(s):	VI-1	
VII-1	<b>International Searching Authority Chosen</b>	Japan Patent Office (ISA/JP)	
VIII	<b>Declarations</b>	Number of declarations	
VIII-1	Declaration as to the identity of the inventor	-	
VIII-2	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to apply for and be granted a patent	-	
VIII-3	Declaration as to the applicant's entitlement, as at the international filing date, to claim the priority of the earlier application	-	
VIII-4	Declaration of inventorship (only for the purposes of the designation of the United States of America)	-	
VIII-5	Declaration as to non-prejudicial disclosures or exceptions to lack of novelty	-	
IX	<b>Check list</b>	number of sheets	electronic file(s) attached
IX-1	Request (including declaration sheets)	4	✓
IX-2	Description	8	✓
IX-3	Claims	1	✓
IX-4	Abstract	1	✓
IX-5	Drawings	4	✓
IX-7	<b>TOTAL</b>	18	

**PCT REQUEST**

Paper Copy (NOT for submission)

	<b>Accompanying Items</b>	paper document(s) attached	electronic file(s) attached
IX-8	Fee calculation sheet	-	✓
IX-11	Copy of general power of attorney	-	✓
IX-17	PCT-SAFE physical media	-	-
IX-19	<b>Figure of the drawings which should accompany the abstract</b>	1	
IX-20	<b>Language of filing of the International application</b>	Japanese	
X-1	<b>Signature of applicant, agent or common representative</b>	/100085372/	
X-1-1	Name (LAST, First)	SUDA, Masayoshi	
X-1-2	Name of signatory		
X-1-3	Capacity		

**FOR RECEIVING OFFICE USE ONLY**

10-1	<b>Date of actual receipt of the purported International application</b>	
10-2	<b>Drawings:</b>	
10-2-1	Received	
10-2-2	Not received	
10-3	<b>Corrected date of actual receipt due to later but timely received papers or drawings completing the purported International application</b>	
10-4	<b>Date of timely receipt of the required corrections under PCT Article 11(2)</b>	
10-5	<b>International Searching Authority</b>	ISA/JP
10-6	<b>Transmittal of search copy delayed until search fee is paid</b>	

**FOR INTERNATIONAL BUREAU USE ONLY**

11-1	<b>Date of receipt of the record copy by the International Bureau</b>	
------	---	--

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

0	受理官庁記入欄 国際出願番号	
0-2	国際出願日	
0-3	(受付印)	
0-4	様式-PCT/RO/101 この特許協力条約に基づく国際出願願書 は、 0-4-1 右記によって作成された。	
0-4-1		JPO-PAS 0321
0-5	申立て 出願人は、この国際出願が特許協力条約 に従って処理されることを請求する。	
0-6	出願人によって指定された受理官庁	日本国特許庁 (RO/JP)
0-7	出願人又は代理人の書類記号	ML6277
I	発明の名称	シリコンウェーハの加工方法
II	出願人 この欄に記載した者は	出願人である (applicant only)
II-1		米国を除く全ての指定国 (all designated States except US)
II-2	右の指定国についての出願人である。	
II-4ja	名称	三菱住友シリコン株式会社
II-4en	Name:	SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION
II-5ja	あて名	1058634 日本国
II-5en	Address:	東京都港区芝浦1丁目2番1号 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 1058634 Japan
II-6	国籍(国名)	日本国 JP
II-7	住所(国名)	日本国 JP
II-8	電話番号	0471-24-2894
II-9	ファクシミリ番号	0471-24-3015
II-11	出願人登録番号	302006854

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

III-1	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-1-2	右の指定国についての出願人である。	古屋田 栄 KOYATA, Sakae
III-1-4en	氏名(姓名) Name (LAST, First):	1058634
III-1-5ja	あて名	日本国 東京都港区芝浦1丁目2番1号三菱住友シリコン株式会社内 c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku Tokyo 1058634
III-1-6	国籍(国名)	Japan
III-1-7	住所(国名)	日本国 JP
III-2	その他の出願人又は発明者 この欄に記載した者は	出願人及び発明者である (applicant and inventor) 米国のみ (US only)
III-2-1	右の指定国についての出願人である。	高石 和成 TAKAISHI, Kazushige
III-2-4ja	氏名(姓名)	1058634
III-2-4en	Name (LAST, First):	日本国 東京都港区芝浦1丁目2番1号三菱住友シリコン株式会社内 c/o SUMITOMO MITSUBISHI SILICON CORPORATION, 2-1, Shibaura 1-chome, Minato-ku, Tokyo 1058634
III-2-5ja	あて名	Japan
III-2-6	国籍(国名)	日本国 JP
III-2-7	住所(国名)	日本国 JP

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

IV-1	代理人又は共通の代表者、通知のあて名 下記の者は国際機関において右記のごとく 出願人のために行動する。 氏名(姓名)	代理人 (agent) 須田 正義 SUDA, Masayoshi	
IV-1-1ja	Name (LAST, First):	1700013	
IV-1-2ja	あて名	日本国 東京都豊島区東池袋1丁目11番1号日本生命東池袋 ビル	
IV-1-2en	Address:	Nissei Higashi-Ikebukuro Bldg., 11-1, Higashi-Ikebukuro 1-chome, Toshima-ku Tokyo 1700013 Japan	
IV-1-3	電話番号	03-3988-4326	
IV-1-4	ファクシミリ番号	03-3986-4443	
IV-1-5	電子メール	suda@suda-pat.com	
IV-1-6	代理人登録番号	100085372	
V	国の指定		
V-1	この願書を用いてされた国際出願は、規則4.9(a)に基づき、国際出願の時点で拘束される全てのPCT締約国を指定し、取得しうるあらゆる種類の保護を求め、及び該当する場合には広域と国内特許の両方を求める国際出願となる。		
VI-1	先の国内出願に基づく優先権主張 出願日	2003年 12月 10日 (10. 12. 2003)	
VI-1-1	出願番号	2003-411287	
VI-1-2	国名	日本国 JP	
VI-2	優先権証明書送付の請求  上記の先の出願のうち、右記の番号のものについて、出願書類の認証謄本を作成し国際事務局へ送付することを、受理官庁に対して請求している。	VI-1	
VII-1	特定された国際調査機関(ISA)	日本国特許庁 (ISA/JP)	
VIII	申立て	申立て数	
VIII-1	発明者の特定に関する申立て	-	
VIII-2	出願し及び特許を与えられる国際出願日ににおける出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-3	先の出願の優先権を主張する国際出願日における出願人の資格に関する申立て	-	
VIII-4	発明者である旨の申立て(米国を指定国とする場合)	-	
VIII-5	不利にならない開示又は新規性喪失の例外に関する申立て	-	
IX	照合欄	用紙の枚数	添付された電子データ
IX-1	願書(申立てを含む)	4	✓
IX-2	明細書	8	✓
IX-3	請求の範囲	1	✓
IX-4	要約	1	✓
IX-5	図面	4	✓
IX-7	合計	18	

## 特許協力条約に基づく国際出願願書

紙面による写し(注意:電子データが原本となります)

	添付書類	添付	添付された電子データ
IX-8	手数料計算用紙	-	✓
IX-11	包括委任状の写し	-	✓
IX-17	PCT-SAFE 電子出願	-	-
IX-19	要約書とともに提示する図の番号	1	
IX-20	国際出願の使用言語名	日本語	
X-1	出願人、代理人又は代表者の記名押印	/100085372/	
X-1-1	氏名(姓名)	須田 正義	
X-1-2	署名者の氏名		
X-1-3	権限		

## 受理官庁記入欄

10-1	国際出願として提出された書類の実際の受理の日	
10-2	図面	
10-2-1	受理された	
10-2-2	不足図面がある	
10-3	国際出願として提出された書類を補完する書類又は図面であってその後期間内に提出されたものの実際の受理の日(訂正日)	
10-4	特許協力条約第11条(2)に基づく必要な補完の期間内の受理の日	
10-5	出願人により特定された国際調査機関	ISA/JP
10-6	調査手数料未払いにつき、国際調査機関に調査用写しを送付していない	

## 国際事務局記入欄

11-1	記録原本の受理の日	
------	-----------	--

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning  
Operations and is not part of the Official Record**

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

- BLACK BORDERS**
- IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES**
- FADED TEXT OR DRAWING**
- BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING**
- SKEWED/SLANTED IMAGES**
- COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS**
- GRAY SCALE DOCUMENTS**
- LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT**
- REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY**
- OTHER:** \_\_\_\_\_

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.**